



平成 29 年 3 月 14 日

各 位

会社名 日 本 曹 達 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 石 井 彰
(コード番号 4 0 4 1 東証第一部)
問合せ先 総務グループリーダー 清 田 周 作
(TEL 0 3 - 3 2 4 5 - 6 0 5 3)

半導体フォトレジスト材料「VP ポリマー」生産能力増強のお知らせ

当社は、半導体フォトレジスト材料「VP ポリマー」製造設備の生産能力増強を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本件の目的

「VP ポリマー (ポリパラヒドロキシシスチレン)」は、半導体用の **KrF** フォトレジスト材料として使用されております。半導体の大容量化・高速化ニーズの高まりに伴う i 線レジストの **KrF** 化や、3次元 NAND 型メモリーの需要拡大などにより **KrF** フォトレジストの使用量は増加しており、当社「VP ポリマー」のニーズが高まっております。

今般、上記の旺盛な需要に対応するとともに安定的な供給体制を確保するために、「VP ポリマー」製造設備の生産能力増強を決定いたしました。

当社は独自に開発したリビングアニオン重合技術により、世界に先駆けて樹脂添加剤「NISSO-PB」および「VP ポリマー」の商業化に成功したメーカーであり、これらの機能性ポリマー事業を当社の成長ドライバーと位置付けて拡大発展を目指しております。今後のさらなる需要の増加に対応するとともに、お客様のニーズに応じた新しいポリマー材料の提供にも取り組んでまいります。

2. 能力増強の概要

- (1) 対象工場 千葉工場 (千葉県市原市)
- (2) 増強内容 50%の生産能力増強
- (3) 投資金額 10 億円
- (4) 完成時期 平成 30 年春

以 上